



# nanoCVD-WGP

## ウエハースケールグラフェン合成装置

Wafer-scale Plasma CVD system for rapid synthesis of high quality 2D application

欧州のアカデミックパートナー (Manchester, Warwick, etc..) の協力の下、実績ある卓上型 nanoCVD-8G (試料サイズ 20mm) に加え、更にウエハースケールでのグラフェン合成装置を開発しました。

Φ3inch、Φ4inch ウエハーサイズ対応 コールドウォール式プラズマ CVD 装置。不純物を抑制し清浄・高品質なグラフェンを高速合成。熱 CVD、低温～高温プラズマ CVD いずれの方法でも利用可能。マスフローガス供給系統、基板加熱ヒーターなどご要望により構成をカスタマイズ致します。



### 【用途】

- 基板：Cu, Ni, 他.. (フィルム, フォイル)
- 原料：CH<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>, solids (PMMA), etc..
- プロセスガス：H<sub>2</sub>, Ar, N<sub>2</sub>, etc..
- 基板サイズ：Φ3inch, Φ4inch
- 150W, 13.56MHz RF 電源
- 500℃～Max1100℃基板加熱
- 高精度プロセスガス圧力 APC 制御
- マスフローコントローラー 最大 4ch

